



חברת אפלייד מטיריאלס הכריזה על מערכת system Etch Photomask Z Tetra Centura לחריטת הדור הבא של מסכות הליתוגרפיה האופטית הנדרשות לתעשייה להמשיך בשידרוג מערכות התבניות המרובות לצמתי 10 ננומטר ומעבר להם. הכלים החדשים מרחיבים את יכולות פלטפורמת טטרה, ומספקים דיוק ברמה של אנגסטרומים בודדים לפרמטרים בממדים קריטיים critical dimension (CD) parameters וזכרון לוגיקה להתקני התבניות הכנת של בדרישות לעמוד הנדרשים "מערכות Z Tetra מייצגות את עתידים. טכנולוגית חריטת ה- photomask החדשה ביותר, המאפשרת הנדסת חומרים מדויקת ותנועה של ריאקציות פלסמה כדי להרחיב את השימוש בליתוגרפיית 193 ננומטר" אומר ראויאלאמאצ'ילי, מנכ"ל חטיבת מסכות החריטה באפלייד מטיריאלס.

[לידיעה המלאה באתר דיג'יטימס](#)